دراسة التأثير المولاري على الخصائص التركيبية لأوكسيد التيتانيوم TiO₂ المحضر بطريقة Sol _ Gel

> رياض سامي عنتر¹ ، رافع عبد الله منيف² ، فارس صالح عطاالله¹ ¹قسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق ²قسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة كركوك ، كركوك ، العراق

الملخص

تم في هذا البحث دراسة التأثير المولاري على الخصائص التركيبية لثنائي أوكسيد التيتانيوم TiO₂ حيث رسبت الاغشية على ارضيات من الزجاج باستخدام محلول (Sol_Gel) ويتقنية Spin_Coting ويسرعة 3000 RPM خلال زمن ترسيب قدره 30sec وتم تحضير المحلول باستخدام مادة اوكسيد التيتانيوم المائي 34[O(CH₂)₃CH₃] و [C₄H₁₁NO₂] كمثبت والايثانول كمذيب (C₃H₈O₂) وحضر المحلول بمولاريات مختلفة من M (0.05,0.1,0.15,0.2,0.3) ويتم تلدين الأغشية بدرجة حرارة 5000 وتم دراسة الخصائص التركيبة من خلال فحوصات (XRD مختلفة من M (0.05,0.1,0.15,0.2,0.3) ويتم تلدين الأغشية بدرجة حرارة 5000 وتم دراسة الخصائص التركيبة من خلال فحوصات (XRD المحلول التدريجي بالطور حيث تبين من النتائج (XRD) ان طور الائتاس هو الطور السائد عند التركيز M (0.05) وبعد زيادة التركيز يبدا التحول التدريجي بالطور حيث يتحول من الانتاس الى الروتايل عند تركيز M.0.20, وبينت فحوصات (SEM) ان الغشاء ذو طبوغرافية جيدة ,وان شكل الحبيبات يكون معيني ثم يتحول من الانتاس الى عناقيد زهرية الشكل, ومن خلال فحوصات (AFM) تبين ان الاغشية ذات سمك نانوي وناعمة وذات اكماء جيد .

الكلمات المفتاحية: أغشية رقيقة ثنائي اوكسيد التيتانيوم , محلول Sol-Gel, TiO2,Spin-Goating, الانتاس , الروتايل

المقدمة

إنَّ تقنية الأغشية الرقيقة ساهمت مساهمة كبيرة في تطوير ودراسة أشباه الموصلات (Semiconductors)، وأعطت فكرة واضحة عن خصائص المواد وتركيبها[1].

ويعد اوكسيد التيتانيوم من الاكاسيد الشفافة (TCO) والتي تحتوي على فجوة طاقة كبيرة وشفافية عالية [2]، حيث يوجد TiO₂ في الطبيعة بثلاثة اطوار رئيسية هي Rutail , Brookite يكون وكل طور من هذه الاطوار له صفات خاصة فيه فطور Rutail يكون اكثر استقرار من باقي الاطوار واكثرها شيوعاً أما طوري Anatase, تحت ظروف معينة من درجة حرارة وضغط وغيرهما [4_6] . كما ان تركيب البلورة في طوري (Anatase, Rutaile) يكون محاط بستة ذرات من الاوكسجين في الفراغ للجسم الثماني [8,7] .

في السنين الأخيرة تم استخدام TiO₂ في التبليقات البيئية [4,9] ويمتلك أوكسيد التيتانيوم صفات فيزيائية جيده جدا [10] منها الصفات الكهربائية والحرارية ومقاوم لدرجات الحرارة العالية ومقاوم للتآكل والصدأ يتفاعل بسهولة مع الأوكسجين والتيتانيوم عنصر لماع ذو كثافة عالية درجة انصهاره عالية نقدر ب (2°1668) وهو عنصر صلب جيد النقل ويستعمل التيتانيوم في الطب في زراعة الاسنان وزراعة العظام لأنه غير سام ويتقبله جسم الانسان .و يستخدم في صناعة السبانك (سبانك الحديد وتيتانيوم). يخلط مع الفولاذ لخفض محتوى الكاربون لكي يقاوم الصدأ [1] . و يستخدم التيتانيوم كسبائك في الطائرات والمدرعات وغير ذلك من الاستخدامات .

تحضير محلول أغشية أوكسيد التيتانيوم (TiO₂)

حضر المحلول TiO2 من مادة نتائي اوكسيد التيتانيوم المائي Artigory (CH2) وCH2), ورمزه (TPT), وهي مادة سائلة ذات لون مائي , ووزنها الجزيئي (A96.38 g/mol), باستخدام Sol_Gel وبتقنية (Spin_Coting .يرسب الغشاء باستخدام منظومة الترسيب Spin_Coting الموضحة في الشكل(1) مجهز قدرة بفولتية دخول قدرها (V 220) للتحكم بسرعة الدوران عن طريق منظم السرعة ومحرك كهربائي يدور بسرعة دوران قصوى مقدارها تقريباً (M3000 rpm) ويتم الترسيب وبسرعة (N2000 دورة خلال زمن ترسيب قدره منافريات مختلفة

المثبتة المبتية (0.05,0.1,0.15,0.2,0.3) وقد تم استخدام المادة المثبتة ($C_4H_{11}NO_2$) (Diethanolaminne) وزن ($C_4H_1NO_2$) وانها مسائي ذات وزن جزئي ($C_3H_8O_2$) ومادة مذيبة هي الايثانول ($C_3H_8O_2$), وبعد تحضير المحلول وتجهيزه يعزل عن المحيط ويترك المحلول 24 ساعة وبعد ذلك يتم وضع المحلول في (Stirring) لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بترشيح المحلول لتخلص من العوالق وبعد ذلك يتم النتظيف حيث تم استخدام قواعد زجاجية ألمانية الصنع بأبعاد (2.5x2.5) في البدء استخدام قواعد زجاجية ألمانية الصنع بأبعاد (2.5x2.5) في البدء يتم تنظيف العينات المراد ترسيب المادة عليها ويتم ذلك بغسل القواعد استخدام قواعد زجاجية ألمانية الصنع بأبعاد (105), ثم وضعها يتم تنظيف العينات المراد ترسيب المادة عليها ويتم ذلك بغسل القواعد وضعها في المادة (10min), ثم وضعها الميثان , ثم تركها لتجف للتخلص من الشوائب والمواد العالقة عليها وغمرها في الماء المقطر الفاتر لمدة (15min). ووضعها في كحول الأستون لمدة (10min) الميثان , ثم تركها لتجف للتخلص من الشوائب والمواد العالقة عليها وغمرها في الماء المقطر الفاتر لمدة (15min). ووضعها في كحول الأستون لمدة (10min) الميثان , ثم تركها لتجف للتخلص من الشوائب والمواد العالقة عليها وغمرها في الماء المقطر الفاتر لمدة (15min). ووضعها في كحول الأستون لمدة المائية عليها ويتم ذلك يتم وضعها في خصعها في مع الميثان , ثم تركها لتجف للتخلص من الشوائب والمواد العالقة المعليها الميثان , ثم تركها لتجف للتخلص من الشوائب والمواد العالقة عليها ولمي قد تؤدي إلى تغير أو تشويه تركيب الغشاء او بعده يتم تجفيف الشرائح باستخدام ورق تجفيف خاص, ثم تلدن الاغشية المحضرة الم

بدرجة حرارة ٢٥٥٥ وبعدها تكون جاهزة للفحص , والجدول (1) يوضح ظروف تحضير الاغشية.



الشكل (1) يوضح صورة جهاز المستخدم في الترسيب

الحسابات والنتائج

تم دراسة الخصائص التركيبية للأغشية 20 TiO المحضرة بطريقة Sol_Gel ويتقنية Spin_coating والمرسبة على ارضيات زجاجية باستخدام جهاز حيود الاشعة السينية لمعرفة طبيعة التبلور للغشاء المرسب, ويتم دراسة طبوغرافية سطح غشاء ثنائي اوكسيد التيتانيوم باستخدام المجهر الماسح الالكتروني (SEM)

للأغشية المرسبه منTiO₂ , وتم دراسة سمك الغشاء وطبيعته باستخدام جهاز (AFM).تظهر الاشكل (2_0)ان اغشية (2) ذات تركيب متعدد التبلور (Polycrystalline). ومن الشكل (2) يلاحظ ان الطور السائد للانتاس هو (101) عند الزاوية (25= 20) عند تركيز (0.05M) وهذه النتيجة مشابهه لنتيجة الباحثين [11_13].



الشكل (2) طيف الأشعة السينية (XRD) لغشاء TiO₂ المرسب على أرضيات زجاجية عند تراكيز 0.05M

ومع زيادة التركيز المولاري الى M (0.1) و من خلال الشكل (3) يتبين ان شدة المستوى تزداد مع زيادة التركيز المولاري ولوحظ ان الشدة عند المستوى (101) تزداد لتصل الى(687) بينما كانت شدة المستوي عند التركيز المولاري M(0.05) حوالي (520) وهذه الزيادة في شدة المستوي تدل على زيادة التبلور او زيادة الحجم الحبيبي او كلاهما وهذه النتيجة مشابه لنتيجة الباحثين [14][15] ووجد عند هذا التركيز ان الانتاس هو الطور السائد في المادة وذو الاتجاه (101) عند الزاوية (25.3= 20) . ومع زيادة التركيز الى M (20.5) بدأ

الغشاء يتحول الى خليط من طورين الروتايل و الانتاس. كما في الشكل(4) نلاحظ ظهور طور الانتاس في الزواية(25.3 و 48) والتي تقابل الاتجاه (101) و (200) على التوالي, ونلاحظ ظهور طور الروتايل في الزواية (2.44 و 36) والتي تقابل الاتجاهات البلورية (101) و (101)على التوالي. وقد وجدنا ان الطور السائد هو طور الانتاس عند المستوى (200) ويقابل الزاوية (48= 20) وهذه النتيجة مشابه لنتيجة الباحثين [16_16].



الشكل (3) طيف الأشعة السينية(XRD) لغشاء TiO₂ المرسب على أرضيات زجاجية عند تراكيز 0.1M

وعند زيادة التركيز الىM (0.2) نلاحظ ان غشاء المرسب بدء ينتقل من الطور المشترك ما بين الانتاس والروتايل الى طور الروتايل ويصاحب هذا الانتقال الزيادة في الحجم الحبيبي مما يؤدي الى زيادة

السمك الغشاء.من الشكل (5) يتبين ان المستوي (110) هو السائد ويقابل الزاوية (27.4= 20) وهذه النتيجة مشابه لنتيجة الباحثين [21_18].



الشكل (4) طيف الأشعة السينية (XRD) لغشاء TiO₂ المرسب على أرضيات زجاجية عند تراكيز 0.15M

وعند زيادة التركيز المولاري الى M(0.3) كما في الشكل (6) نلاحظ تتاقص في درجة التبلور بسبب زيادة تكتل الايونات TiO2 في المحلول المرسب للغشاء وان الاتجاه السائد هو (110) الذي يقابل الزاوية (27.4= 20) . تم استخدام تقنية (SEM) لمعرفة طبيعة سطح الأغشية وحساب الحجم الحبيبي حيث يزودنا المجهر الالكتروني الماسح بصورة مجسمة تفيدنا في دراسة طبوغرافية السطح

والتحاليل المجهرية ومعرفة التركيب الكيميائي للمواد والشكل(7) يوضح صورة SEM للغشاء المرسب على ارضية زجاجية بتركيز M (0.05) ويظهر من خلال الشكل(7A) ان الغشاء مكون من حبيبات سداسية غير متماثلة الشكل وغير منتظمة تماما. والغشاء خالي من الفجوات مع احتوائها على مسافات بينية كبيرة.



الشكل (5) طيف الأشعة السينية (XRD) لغشاء TiO₂ المرسب على أرضيات زجاجية عند تراكيز 0.2M



الشكل (6) طيف الأشعة السينية (XRD) لغشاء TiO₂ المرسب على أرضيات زجاجية عند تراكيز 0.3M

نلاحظ من الشكل (7B) مع زيادة التركيز المولاري الـيM (0.1) يكون شكل الحبيبات معيني اكثر انتظاما وذات توزيع أكثف ومنتظم وقليل الفراغات واكثر خشونة من التركيز M (0.05) بسبب زيادة التركيز اي زيادة ترسيب ايونات TiO₂ وهذا يدل على ان الحجم البلوري الابتدائى للطور Anatase يزداد بزيادة التركيز المولاري والذي يزيد من تجمع الجزيئات مع بعضها البعض على شريحة والشكل (7C) يوضح صورة الغشاء المرسب على ارضية من الزجاج. مع زيادة التركيز المولاري الـي M (0.15) يكون سطح الغشاء المرسب اكثر كثافة وقليل الفراغات وقريب من الشكل الكروي ومختلف عن التراكيز السابقة و يظهر زيادة في خشونة السطح مع نقصان في المسافات البينية الفاصلة بين الجزيئات ويرافقها زيادة في متوسط حجم الحبيبات ويعود السبب في ذلك إلى أن الحجم البلوري الابتدائي للطورين Anatase و Rutile يزداد بزيادة التركيز المولاري والذي يزيد من تجمع الجزيئات مع بعضها البعض, والشكل (7D) وعند زيادة التركيز الىM (0.2) يكون سطح الغشاء المرسب كثيف جداً وقليل الفراغات على الشكل عناقيد زهرية ومختلف عن التراكيز السابقة و يظهر زيادة في خشونة السطح مع زيادة التركيز المولاري حيث تكون علاقة الخشونة مع التركيز علاقة طردية, ونلاحظ نقصان في المسافات البينية الفاصلة بين الجزيئات مع زيادة التركيز المولاري وتكون العلاقة ما بين المسافات البينية الفاصلة بين الجزيئات والتركيز علاقة عكسية ويرافقها زيادة في متوسط حجم الحبيبات ويعود السبب في ذلك إلى أن الحجم البلوري الابتدائي لطور Rutile يزداد بزيادة التركيز المولاري والذي يزيد من تجمع الجزيئات مع بعضها البعض, وهذه النتائج مقاربة للباحثين [23,22] والجدول(2) يوضح خلاصة الخصائص التركيبية TiO₂ وتم ايجاد الحجم الحبيبي باستخدام معادلة التالبة:

$$D_{av} = \frac{0.94\lambda}{B\cos\theta_B} \quad \dots 1$$

هي عرض المنحنى عند منتصف الذروة العظمى (FWHM). λ : يمثل الطول الموجي للحزمة الساقطة , θ هي زاوية الانعكاس [10]

كما تم أستخدم مجهر القوة الذرية (AFM) في دراسة طبوغرافية السطح والتركيب البلوري السطحي لطبقات الطلاء والشكل (8) يوضح

صورة الاغشية المرسبة, ومن خلاله تم حساب الحجم الحبيبي (size Grain), ومعدل خشونة السطح (Roughness Average), ومتوسط قيمة الجذر التربيعي (Root Mean Square). صور مجهر (AFM) لمنطقة قياس بمساحة (AFM) لمنطقة قياس بمساحة (Size=2032×2044nm) وقدرة تحليلية (Pixels= 492×496) لطبوغرافية طبقة الطلاء التي حضرت بطريقة , Sol_Gel وبتقنية Spin _ Coating والشكل (8) يوضح صورة (3D) التي تم تحليلها باستخدام مجهر AFM ومن خلال الفحص تبين انه بزيادة التركيز المولاري يزداد كل من الحجم الحبيبي والخشونة ومتوسط الجذر التربيعي وكذلك تزداد اعلى قمة بلورية على السطح ومن خلال الشكل(8A) ان الغشاء بتركيز M(0.05) يمتلك اقل سمك ومع زيادة التركيز الى M(0.1) كما في الشكل (8B) نجد ان خشونة السطح تزداد وكذلك السمك, والشكل (8C) هو صورة الغشاء بتركيز M(0.15) ومع زيادة التركيز الي (0.2) كما في الشكل (8D) تزداد خشونة و سمك الغشاء وكذلك تزداد اعلى قمم بلورية, ومع زيادة التركيز الى 0.3M حيث ان طور الروتيل أكثر سمك من الانتاس كما في الشكل(8E) نلاحظ ان هذا الغشاء يعطى اعلى سمك واعلى تركيز مقارنة بالتراكيز السابقة بسبب زيادة تركيز ايونات ثنائي أوكسيد التيتانيوم في المحلول المرسب والجدول(3) يبين نتائج الفحص. وهذه النتائج مقاربة للباحثين [25,24]

الاستنتاجات

ان اغشية Sol_Gel المحضرة بطريقة Sol_Gel وبتقنية Spin_Coating ذات تركيب متعدد التبلور و كلما زاد التركيز المولاري زاد الحجم الحبيبي وبزيادة التركيز المولاري تجري عملية التحول في الاطوار الاغشية المرسبه من طور الانتاس الى طور الروتايل. من فحوصات SEM يتبين ان شكل الحبيبات سداسي ويتحول الى معيني بزيادة التركيز , وعند زيادة التركيز المولاري يتم تحولها الى عناقيد زهرية, وبزيادة التركيز المولاري فان سطح الأغشية يكون أخشن ويرافقها زيادة في الحجم الحبيبي وخاصة لطوري الروتايل والانتاس. من فحوصات AFM نلاحظ طبيعة السطح حيث بزيادة التركيز المولاري يزداد خشونة السطح ,ومن فحوصات المحلان سمك الغشاء نانوي وان الاغشية ناعمة وذات اكساء جيد , ويمكن الاستفادة منها في تصنيع الخلايا الشمسية .

تركيز المادة M	وزن مادة g	وزن g المثبت	التجفيف 15 °C min	التلدين 1h °C	Stirring 1h °C	AGEING H
0.05	0.99	0.21	250°C	500	(60-70)	24
0.1	1.99	0.42	250°C	500	(60-70)	24
0.15	2.97	0.63	250°C	500	(70-75)	24
0.2	3.97	0.84	250°C	500	(70-75)	24
0.3	5.95	1.26	250°C	500	(70-75)	24

الجدول(1) يبين الاوزان المولاريات وظروف الترسيب المستخدمة في البحث

الجدول(2) يعطي المعلومات التي تم الحصول عليها من الفحوصات التركيبية

Μ	20	AHFW	(hkl)	d A	G nm (XRD)	G nm (SEM)	G nm (AFM)
0.05	25.3	(0.102)	A(101)	3.5	79.8	38.17	87.33
	38.5	(0.121)	A(112)	2.3	69.5		
	48	(0.12)	A(200)	1.89	72.5		
0.1	25.3	(0.1)	A(101)	3.5	81.9	43.91	91.36
	36.9	(0.13)	A(103)	2.43	64.4		
	48	(0.14)	A(200)	1.89	62.15		
	55	(0.149)	A(211)	1.67	60		
0.15	25.3	(0.154)	A(101)	3.5	53	63.74	94.18
	48	(0.139)	A(200)	1.89	62.6		
	39.1	(0.092)	R(200)	1.67	91.87		
	36	(0.099)	R(101)	2.3	88.9		
0.2	27.4	(0.09)	R(110)	3.25	91	83.24	97.12
	36	(0.089)	R(101)	3.4	93.7		
0.3	27.4	(0.0757)	R(110)	3.25	108	313.6	124.39
	36.06	(0.0827)	R(101)	2.48	101		

الجدول (3) يعطي المعلومات التي تم الحصول عليها من فحص AFM

Concentration	Roughness	RMS	G.H.Grain	Avy.Diameter
0.05	0.803	0.922	4.96	87.33
0.1	1.06	1.22	5.29	91.36
0.15	1.01	1.18	4.91	94.18
0.2	3.33	3.88	19.57	97.12
0.3	4.58	5.34	27.78	124.39



الشكل(7) يوضح صورة الاغشية من خلال جهاز SEM للمولاريات M(0.05,0.1,0.15,0.2,0.3)



الشكل(8) يوضح صورة الاغشية من خلال جهاز AFM للمولاريات M(0.05,0.1,0.15,0.2,0.3)

المصادر

- [1] J. R. Son, "Thin Film Technologies", 2nd Ed. (1986).
- [2] A. Roth, D .Williams "properities of ZnO films prepared by oxidation of diethylzinc", J. Appl. Phys, 52 6685. (1981).
- [3] K. Karki, K.I. Gnanasekar and B. Rambabu "Nanostructure Semiconductor Oxide Powders and Thin Films for Gas Sensors" Appl. Sur. Sci. ,Vol. 193-195, p.399, (2006).
- [4] V. Stengl, et, Materal Chemisttry and Physics 105 38(2007)
- [5] H. Bensmira, Thèse de magister, Université Mentouri, Constantine(2004).
- [6] Ulrike diebdd, *Surface Science reports* 48 53_229 (2003).
- [7] V. Nelea, *Surface and Coatings Technology* 173 315 (2003).
- [8] A. Ibrahim Mater.et al, Res .Soc. Symp. Proc. Vol. 848 20 (2005).
- [9] D. Gong, C.A. Grimes, O.K. Varghese, W. Hu, R.S. Singh, Z. Chen, E.C. Dickey, J. Mater. Res. 16 3331(2001).

[10] يمان ،تأثير سماحى معالجة الحرارية على طبقات رقيقة من

المرسب على مسند من الزجاج ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية

- الرياضيات وعلوم المادة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،(2014).
- [11] R.S. Suciu and G.I. Rusu, " On the Electrical Properties of TiO₂ Thin Film", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials ,Vol. 7, p234, (2005).
- [12] I.Senain,et, "Structural and Electrical Properties of TiO2 Thin film Derived from Sol-gel Method using Titanium (IV) Butoxide ", International Journal of Integrated Engineering (Issue on Electrical and Electronic Engineering).
- [13] S.G. Pawar, et, "Effect Of Annealing On Structure, Morphology, Electrical And Optical Properties Of Nanocrystalline TiO2 Thin Film, J. Nano- Electron. Phys, 3 No1, P.185-192 (2011).
- [14] S. K. Gupta,et," *Titanium dioxide synthesized* using titanium chloride: Size effect study using Raman and Photoluminescence", Department of Physics, M.Sc. Thesis Bhavnagar University, Bhavnagar, 364 022, Gujarat, India
- [15] T. Ranganayaki, et, "Preparation and Characterization of Nanocrystalline TiO2 Thin Films Prepared By Sol-Gel Spin Coating Method", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, (An ISO 3297:

2007 Certified Organization) Vol.3, Issue 10, October (2014)

- [16] M. L. Vera, et ,et, "Characterization of TiO2 Nanofilms obtained by Sol-gel and Anodic oxidation", Nanomater Nanotechnol, , 4:10 | doi: 10.5772/58522. (2014)
- [17] X. Wang, et, "Optical Constants of Crystallized TiO2 Coatings Prepared by Sol-Gel Process", Materials, 6, 2819-2830; doi:10.3390/ma6072819. (2013).
- [18] Mohammed. H., "Preparation of Titanium Dioxide (TiO2) Via the Sol-Gel Process", M.Sc. Thesis University of Basrah, College of Education, Department of Physics (2007)
- [19] Y. Sam Jin and H. Wook Choi," The effect of different TiO2 passivating layers on the photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells", Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 13, No. 2, pp. 178~183 (2012).
- [20] P. Malliga, et, "Influence of Film Thickness on Structural and Optical Properties of Sol – Gel Spin Coated TiO2 Thin Film", IOSR Journal of Applied
- Physics (IOSR-JAP)(e-ISSN: 2278-4861. Volume 6, Issue 1 Ver. I PP 22-28 (Jan. 2014).
- [21] Ching-Hua Wei and Ching-Min Chang, "Polycrystalline TiO2 Thin Films with Different Thicknesses Deposited on Unheated Substrates Using RF Magnetron Sputtering", Materials Transactions, Vol. 52, No. 3 pp. 554 to 559 (2011).
- [22] M. SINGH, et, "Sol gel spin coated TiO2 films for transparent window Applications", Material Science Research, Laboratory, Department of Physics, Guru Nanak Dev University, Amritsar, India, Journal Of Optoelecronics And Advanced Materials Vol. 14, No. 7-8, July – August, p. 624 – 629 (2012).
- [23] A.H. Mayabadi, et, Evolution of structural and optical properties of rutile TiO2 thin films synthesized at room temperature by chemical bath deposition method, J. Phys. Chem. Solids (2013),
- [24] W. Niu, et, "Preparation and Electrochromic Performance of TiO2 Thin Film", Int. J. Electrochem. Sci., 10 2613 – 2620 (2015).
- [25] Ching-Hua Wei and Ching-Min Chang," Polycrystalline TiO2 Thin Films with Different Thicknesses Deposited on Unheated Substrates Using RF Magnetron Sputtering", Materials Transactions, Vol. 52, No. 3 pp. 554 to 559 (2011).

Study The Molarity Influence on the structural properties of titanium oxide (TiO₂) Prepared with (Sol_Gel)

Riyadh sami¹, Rafea A. Munef², Fares Saleh Atallah¹

¹Department of Physics, College of Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq

² Department of Physics, College of Science, Kirkuk University, Kirkuk, Iraq

Abstract

This report was conducted to study the molar effect on structural characteristics of Titanium dioxide TiO₂ ,the deposition of films on glass substrates was done by using sol gel solution with Spin-Coting method (speed =3000 rpm) during 30 sec of the deposition where the solution have been prepared using Titanium hydroxyl Material Ti[O(CH₂)₃(CH₃)]₄ and C₄H₁₁NO₂ as Fixative and Ethanol as a solvent. we have prepared different concentrations of solution (0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30) M ,the films have been annealing with temperature (500 °C), we have investigated the Structural characteristics using (XRD,AFM and SEM) analyses. The (XRD) results have shown that the Anatase phase is the prevalent phase when the concentrations (0.05 and 0.10)M and after increase the concentration start changes gradually from Anatase phase to Rutile phase when the concentration (0.2)M. The SEM analyses have approved that the film has good topography. The granules had a rhombus form then its shape became cluster with the increasing of concentration . The (AFM) have shown that the membranes had nano- thickness, and they are soft with good coating

Keywords: thin films titanium oxide, TiO₂, Spin-Coating ,Sol-Gel ,Antase ,Rutile